



- (51) 국제특허분류:
B24D 11/00 (2006.01) B24D 3/16 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2013/001085
- (22) 국제출원일: 2013년 2월 12일 (12.02.2013)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2012-0054523 2012년 5월 23일 (23.05.2012) KR
- (71) 출원인: 케이피엑스케미칼주식회사 (KPX CHEMICAL CO., LTD.) [KR/KR]; 121-805 서울시 마포구 공덕동 473 KPX 빌딩 15층, Seoul (KR). 삼성전자주식회사 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) [KR/KR]; 443-742 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 안봉수 (AHN, Bong-Su); 143-190 서울시 광진구 자양동 이튼타워리버 2차 A동 803호, Seoul (KR). 강영준 (JANG, Young-Jun); 443-706 경기도 수원시 영통구 망포동 엘지빌리지 1차 109-207, Gyeonggi-do (KR). 정진수 (JEONG, Jin-Su); 121-040 서울시 마포구 도화동 현대 1차아파트 104-406, Seoul (KR). 이상목 (LEE, Sang-Mok); 121-775 서울시 마포구 공덕동 43번지 삼성래미안공덕 2차아파트 108-1802, Seoul (KR).

송기천 (SONG, Kee-Cheon); 680-042 울산시 남구 야음 2동 789-6 동부아파트 302-1101, Ulsan (KR). 김승근 (KIM, Seung-Geun); 680-842 울산시 남구 야음 2동 789-6 동부아파트 102-1305, Ulsan (KR). 서장원 (SEO, Jang-Won); 612-712 부산시 해운대구 재송 1동 1200 더샵센텀파크 1차아파트 102-2602, Busan (KR). 추정선 (CHOO, Jeong-Seon); 607-122 부산시 동래구 사직 2동 목림빌라 가동 102호, Busan (KR). 강학수 (KANG, Hak-Su); 641-809 경상남도 창원시 의창구 도계동 327-6, Gyeongsangnam-do (KR). 공경표 (KONG, Gyoung-Pyo); 681-764 울산시 중구 태화동 강변맨션 1-302, Ulsan (KR).

(74) 대리인: 김함곤 (KIM, Ham-Kon); 135-080 서울시 강남구 역삼동 668-2 용마빌딩 2층, Seoul (KR).

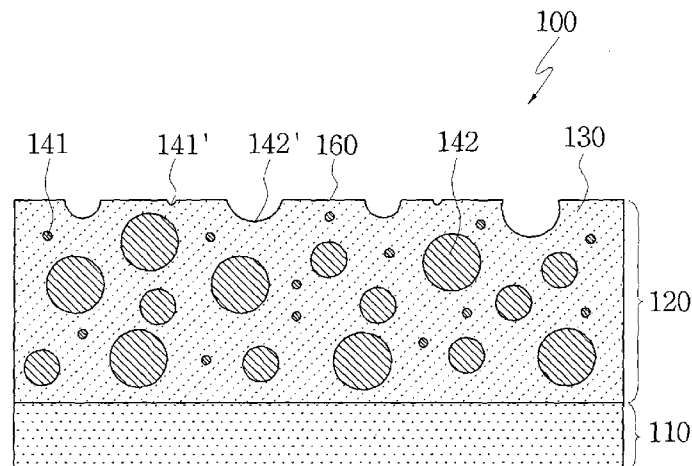
(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD,

[다음 쪽 계속]

(54) Title: POLISHING PAD AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 발명의 명칭: 연마패드 및 그 제조방법

[Fig 1]



(57) Abstract: According to the present invention, the method for manufacturing a polishing pad by mixing a polishing layer forming material and solidifying the material through a chemical reaction includes: a step of forming micro organic particles by pulverizing an organic material using a physical method; a step of mixing the micro organic particles formed in the above step with the polishing layer forming material; a step of forming gaseous pores by mixing the mixture obtained in the above step with a pore size-controllable inert gas, a capsule-type foaming agent, or a chemical foaming agent; a step of producing a polishing layer by gelating and curing the mixture obtained in the above step; and a step of distributing the pores through the opening of the gaseous pores on a surface by processing the polishing layer.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]



SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

본 발명에 따른 연마층 형성 물질을 혼합시키고 화학적 반응에 의해 고상화시켜 연마 패드를 제조하는 방법은, 유기물을 물리적 방법으로 분쇄하여 미세 유기 입자로 형성시키는 단계와; 상기 단계에서 형성된 미세 유기 입자를 상기 연마층 형성 물질에 혼합시키는 단계와; 상기 단계의 혼합물에 포어 사이즈 컨트롤이 가능한 불활성 기체, 캡슐형 발포제, 화학적 발포제 중 적어도 어느 하나를 혼합하여, 기상 포어를 형성하는 단계와; 상기 단계를 통해 생성된 혼합물을 겔화 및 경화시켜 연마층을 제조하는 단계와; 상기 연마층을 가공하여 표면에 기상 포어의 개방에 의한 기공들을 분포시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.